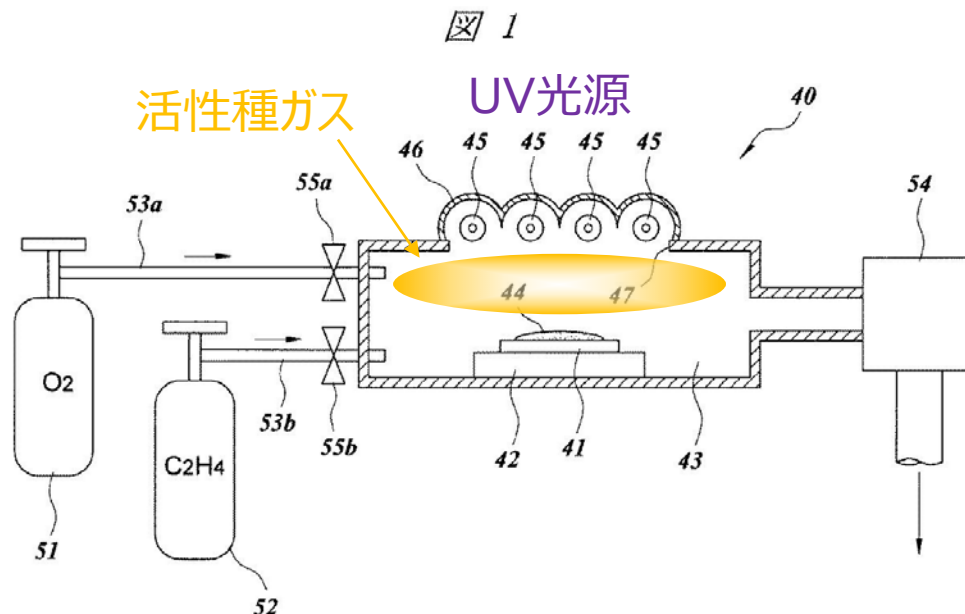


# 9. UVを利用するクリーニング方法及び装置

日本特許第5,678,671号

UV照射により活性化されたガスにより、被処理部材にダメージを与えることなく炭素汚染を除去することが可能な装置



40 : クリーニング装置 41 : 多層膜ミラー 43 : 処理室  
44 : 炭素コンタミネーション 45 : 水銀ランプ 46 : 光照射装置  
51 : 酸素供給源 52 : 不飽和炭化水素供給源

# 9. UVを利用するクリーニング方法及び装置

日本特許第5,678,671号

**UV照射により活性化されたガスにより、被処理部材にダメージを与えることなく炭素汚染を除去することが可能な装置**

- 被処理部材に制限はない
- 励起ガスは酸素及びエチレンを使う
- ナノオーダの炭素コンタミを分解除去可能

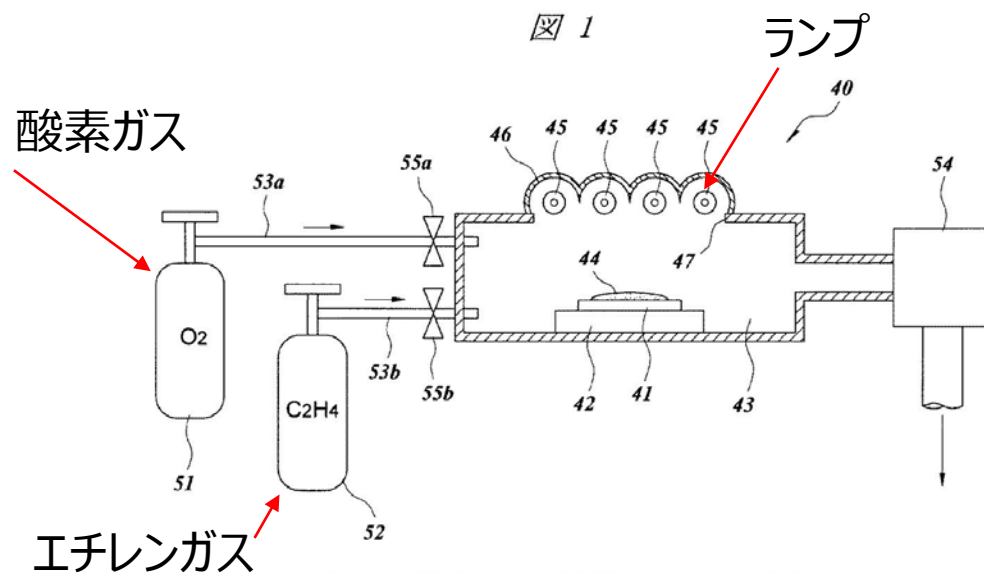


図1 クリーニング装置 41: 多層膜ミラー 43: 処理室  
44: 炭素コンタミネーション 45: 水銀ランプ 46: 光照射装置  
51: 酸素供給源 52: 不飽和炭化水素供給源

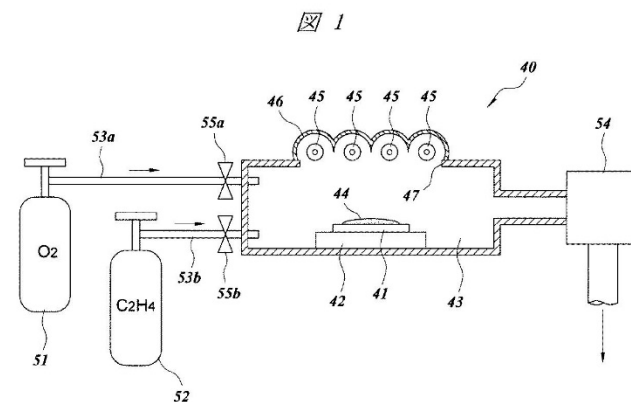
# 9. UVを利用するクリーニング方法及び装置

日本特許第5,678,671号

## <応用例>

■ 電子線を用いる測定装置 (TEM) のミラー、レンズに対するクリーニング

■ コンタクトレンズの炭素コンタミ (たんぱく質、脂質) を分解除去  
・UVにより殺菌と洗浄を同時実行



40 : クリーニング装置 41 : 多層膜ミラー 43 : 処理室  
44 : 炭素コンタミネーション 45 : 水銀ランプ 46 : 光照射装置  
51 : 酸素供給源 52 : 不飽和炭化水素供給源